

公開講義

「意匠制度の概要と課題」第2回

今年の四月から意匠権の存続期間の延長、画面デザインの保護の拡充、意匠の類似の範囲の明確化、部分意匠等の保護の拡充、関連意匠の保護の拡充及び秘密意匠の保護の見直し等について改正が行われ施行されました。本講義では、これらの最新の情報を分かりやすく詳細に説明して頂きます。

第一回を受講できなかった方も、一回目とは内容も異なり立法の趣旨や法文の分かりやすい解説をして頂けますので、ふるってご参加下さい。

◆講師：特許庁 審査業務部産業機器
川崎 芳孝 上席審査長

◆場所：共通教育棟 C401教室

◆受講料：5,200円

(但し、大阪大学の学生・教職員は無料)

→受講決定通知後に、指定の銀行口座へ
12月4日(火)までにお振り込み願います。

◆日時：平成19年12月6日(木)
13時00分～16時10分

《参加申込》下記E-mailにて、①参加希望講義名②氏名③所属④TEL⑤アドレスを、
12月3日(月)16時までにお送り下さい。

(宛先)大阪大学大学院法学研究科附属法政実務連携センター

E-mail→renkei21@law.osaka-u.ac.jp

Tel 06-6850-5173